

<第 258 回講演会>

日 時 : 2024 年 4 月 25 日(木) 13:30~17:00

会 場 : オンライン (Zoom) での開催

テーマ : 『次世代リソグラフィ技術の展開』

フォトポリマー懇話会会員 : 無料 (人数制限なし)

非会員 : 3,000 円、学生 : 2,000 円 (4 月 18 日 (木) までにお振り込みください)

テキストはダウンロード方式とします。

[参加申込]

フォトポリマー懇話会ホームページ [www.tapi.jp](http://www.tapi.jp) のメールフォームからお申し込みください (4 月 18 日 (木) 締切)

[プログラム]

1. 13:30~14:30

「EUV リソグラフィの現状と課題」

兵庫県立大学 渡邊 健夫 氏

2. 14:40~15:40

「EUVL レジストプロセスの最新動向」

大阪大学 産業科学研究所 古澤 孝弘 氏

3. 15:50~16:50

「先端感光性材料の現状と今後」

東洋合成工業(株) 榎本 智至 氏

16:50~17:00 ブレイクアウトルーム